

低炭素関連装置 運用細目

装置名	集束イオン／電子ビーム加工観察装置
設置場所	早稲田大学ナノ理工学研究機構 地下1階007室
装置管理者	由比藤 勇
取扱責任者	由比藤 勇

1 パワーユーザの必要要件、権限範囲

- (1) パワーユーザとは、装置の停止、立ち上げ、一般管理（記録、備品準備など）等に関して扱い責任者と同等の技量を持ち、かつ、精密装置の操作に適した感性、几帳面さを持つ者である。
- (2) パワーユーザは各研究室で1名決める。パワーユーザを決めることができない研究室は、他研究室のパワーユーザが兼務しても可（事前に依頼すること）。
- (3) パワーユーザは取扱責任者の講習を受け、合格した者とする。また、定期的な講習を通して、技量の維持向上を図る。
- (4) パワーユーザは、一般利用者の補助を行う。特に、クロスポイント調整、試料高さ調整、装置内への取り付け、FIB/SEMの位置調整、試料取り外し、データの取り出し、TEM試料作製のためのマイクロサンプリングに関してはパワーユーザのみが行い、一般利用者は操作できない。

2 一般利用者の定義について

- (1) 一般利用者は、S4800 およびFB2000A のライセンスを持つかそれと同様の技量を有し、FESEM およびFIB を十分に操作できる者とする。
- (2) 1の(4)を満足する者のうち、希望者について取扱い責任者が講習を行い合格した者のみ利用可とする。ただし、FB2000A で対応不可の場合に限る。
- (3) 学外からの利用依頼に関する各種事務手続きは、まずナノ理工学研究機構で対応する。

3 利用制限、禁止行為について

- (1) 本装置による一般開放の操作は、断面観察およびこれに関連する操作とする。